

DIN Normenausschuß Feinmechanik und Optik; AA O3 Dünne Schichten für die Optik

- Committee Draft ISO/CD 16150-1 Optics and optical instruments – Characterization of optical materials used in the spectral range (0,78 – 100 µm) for infra-red.
Part 1: General properties
 - Committee Draft ISO/CD 16150-2 Optics and optical instruments – Characterization of optical materials used in the spectral range (0,78 – 100 µm) for infra-red.
Part 2: Optical properties
- wurden auf der letzten Sitzung des ISO/TC172/SC3 im April 2002 akzeptiert und werden als Grundlage eines Normentwurfs weiter bearbeitet.
- Committee Draft CD ISO 9211-4 Optical Coatings, Part 4 Specific Test methods wurde als Entwurf einer Überarbeitung einer bestehenden Norm verabschiedet.

VDI-Gesellschaft Produktionstechnik; Richtlinien-Fachauschuß "Diamantwerkzeuge"

Die Arbeiten an der VDI Richtlinie VDI 2840 Kohlenstoffschichten – Übersicht über Schichttypen und Eigenschaften wurden fortgesetzt. Die Verabschiedung der Richtlinie ist für die nächste Sitzung (5./6.3.03 in Braunschweig) vorgesehen.

VDI-W : VDI-Richtlinie # 3823 „Qualitätssicherung bei der Vakuumbeschichtung von Kunststoffen“

VDI 3823 Qualitätssicherung bei der Vakuumbeschichtung von Kunststoffen.

Blatt 1: "Eigenschaften, Anwendungen und Verfahren" Gründruck
Blatt 2: "Anforderungen an zu beschichtende Kunststoffteile" in den Gründruck verabschiedet.

Blatt 3: „Fertigungsabläufe und Tätigkeiten“ ; Mit der Erarbeitung wurde begonnen.
(1. Entwurf wird auf der nächsten Sitzung vorliegen)

Blatt 4: "Prüfplanung für vakuumbeschichtete Kunststoffteile" Dritter Entwurf liegt vor.
Nächste Sitzung 20./21.02.2003 in Düsseldorf (VDI)

VDI/VDE-GMA-Fachauschuß FG 3.40 „Metrologie in der Mikro- und Nanotechnik“

In den Ausschüssen werden diverser Richtlinienentwürfe diskutiert, u.a.:

- Richtlinienvorschlag für die Kalibrierung von Interferenzmikroskopen und konfokalen Mikroskopen für die Rauheitsmessung
- "Anwendungsatlas Rauheitsmesstechnik"
- Richtlinienentwurf "Kalibrierung von optischen Rauheitsmessgeräten"
- Richtlinienentwurf "Rauheitsmessung mit Streulichtmethoden"
- Richtlinienentwurf "Kalibrierung von Rastersondenmikroskopen"
- Richtlinienentwurf "Formmessung mit optischen Messgeräten"
- Kalibriernormale für optische Oberflächenmessgeräte

Die nächste Sitzung findet am 6.12.2002 in Frankfurt statt.

DIN NMP 141 Härteprüfung

Der Normentwurf ISO/DIS 14577 „Metallic materials – Instrumented indentation test for hardness and materials parameters“ wurde zum 31.10.2002 durch ISO/TC 164 in eine Norm überführt.

Der Teil 4 „Measurement for coatings“ wurde von deutschen Experten innerhalb des DIN NMP 141 diskutiert. Die dort erarbeiteten Veränderungsvorschläge werden im Dezember auf einer Sitzung des ISO/TC 164 vorgestellt.

ISO/TC 201 Oberflächenanalytik : Aktueller Stand

Organisation des ISO/TC 201:

- 8 Subkomitees und 1 Arbeitsgruppe
- 30 Länder sind durch ihre nationalen Standardisierungsorganisationen vertreten. Hiervon sind 10 Länder "participating members" (China, Italien, Japan, Rep. Korea, Österreich, Russische Föderation, Schweiz, Slowenien, UK, USA). Weitere 20 Länder (u.a. Deutschland) haben einen Beobachterstatus.

Status der Normenentwicklung durch ISO/TC 201:

- Insgesamt: 33; ISO: 8, ISO/TR: 1, PRF: 1, FDIS: 2, DIS: 2, CD: 5, WD: 5, NP: 5, AWI: 4
 ISO= International Standard; PRF= Proof of a new International Standard; FDIS= Final Draft International Standard; ISO/TR= ISO Technical Report; DIS= Draft International Standard; CD= Committee Draft ; WD= Working Draft ; AWI= Approved Work Item; NP= New Work Item Proposal

Bisher veröffentlichte Internationale Normen:

- ISO14976** Surface Chemical Analysis -Data transfer format
(Norm bedeutsam für Austausch von oberflächenanalytischen Daten)
- ISO14975** Surface Chemical Analysis -Information formats
(Norm bedeutsam für Austausch von oberflächenanalytischen Daten)
- ISO 14237** Surface Chemical Analysis - Secondary ion mass spectrometry - Determination of boron content in silicon using uniformly doped materials
(Norm bedeutsam für Halbleiterindustrie)
- ISO 14606** Surface Chemical Analysis - Sputter depth profiling - Optimization using layered systems as reference materials
(Norm bedeutsam für Halbleiterindustrie)
- ISO 15472** Surface Chemical Analysis - X-ray photoelectron spectrometers - Calibration of energy scales
(Norm bedeutsam für akkreditierte Prüflaboratorien)
- ISO 17974** Surface Chemical Analysis – High-resolution Auger electron spectrometers - Calibration of energy scales for elemental and chemical-state analysis
(Norm bedeutsam für akkreditierte Prüflaboratorien)
- ISO 14707** Glow discharge optical emission spectrometry (GDOES) - Introduction to use
(Norm bedeutsam für Automobil- und Stahlindustrie)
- ISO 14706** Surface Chemical Analysis - Test method of surface elemental contamination on silicon wafers by total reflection X-ray fluorescence spectroscopy
(Norm bedeutsam für Halbleiterindustrie)
- ISO 18115** Surface chemical analysis – Vocabulary
(Norm bedeutsam für oberflächenanalytische Labore und Industrie)
- ISO/TR 15969** Surface Chemical Analysis - Depth profiling - Measurement of sputtered depth
(Norm bedeutsam für Automobil-, Stahl- und Halbleiterindustrie)

Weitere Informationen zum laufenden Arbeitsprogramm sind verfügbar unter :
http://www.bam.de/kompetenzen/arbeitsgebiete/abteilung_8/fachgruppe_82/laboratorium_823.htm

ISO/TC 202 : AktuellerStand

Organisation des ISO/TC 202:

- 4 Subkomitees sowie weitere 4 Arbeitsgruppen, die direkt dem TC Sekretariat unterstellt sind (Die bisherige AG 3 "SEM" wurde in ein Subkomitee umgewandelt)
- Web-Seite zur Information über die ISO TC202-Aktivitäten:
www.msa.microscopy.com/ISO/
- Die diesjährige Plenarsitzung fand vom 16. bis 18.9. 2002 in der BAM statt.

Status der Normenentwicklung durch ISO/TC 202:

FDIS: 1, DIS: 1, CD: 5, WD: 1

Nr	Inhalt der Norm	Status
ISO 15632	Spezifikationen für energiedispersive Röntgenspektrometer	FDIS (50.00)
ISO 16700	Vorschrift zur Kalibrierung der Vergrößerung am REM	CD (30.20)
ISO 22029	EMSA/MAS Standard file format for spectral data exchange	DIS (40.60)
ISO 14594	Testmethoden für Elektronenstrahl-Mikrosonden	CD (30.99)
ISO 15595	Anforderungen an ein CRM für die Elektronenstrahl-Mikroanalyse	CD (30.99)
ISO 17470	Vorschrift zur qualitativen Elektronenstrahl-Mikroanalyse	CD (30.20)
ISO 22489	Anleitung zur quantitativen Punktanalyse bei der ESMA	NP (10.20)
ISO 22309	Anleitung zur quantitativen Analyse mittels EDX	WD (20.20)
ISO 17270	Vorschrift zur Durchführung der ELS am STEM	AWI (20.00)
ISO 23833	Vokabular	CD (30.20)

Weitere Informationen zum laufenden Arbeitsprogramm sind verfügbar unter :
http://www.bam.de/kompetenzen/arbeitsgebiete/abteilung_8/fachgruppe_82/laboratorium_823.htm

gez. G. Reiners
 Tel.: 030/8104-1820; FAX: -1827,
 Email: georg.reiners@bam.de,
<http://www.bam.de/fq-82.htm>